

# **PERIODIC INP/AIR STRUCTURES IN OPTICAL FILTER DEVICES**

von

Thomas Kusserow

## **DISSERTATION**

Eingereicht zur Erlangung des akademischen Grades eines  
Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)  
im Fachbereich Elektrotechnik / Informatik  
der Universität Kassel

Kassel, September 2010

Diese Arbeit wurde zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat) im Fachbereich Elektrotechnik / Informatik der Universität Kassel vorgelegt und angenommen.

Eingereicht am  
Tag der Disputation

15. September 2010  
09. Dezember 2010

Gutachter:

Prof. Dr. Hartmut Hillmer  
Prof. Dr. Peter Meißner

Promotionskommission:

Prof. Dr. Hartmut Hillmer  
Prof. Dr. Peter Meißner  
Prof. Dr. Axel Bangert  
Prof. Dr. Bernd Witzigmann

**Title:** Periodic InP/Air Structures in Optical Filter Devices

**Author:** Thomas Kusserow

**Reviewer:** Prof. Dr. Hartmut Hillmer / Prof. Dr. Peter Meißner

**Abstract:** In this thesis periodic structures consisting of InP and air features are investigated concerning their application in optical filter elements. Fabry-Pérot filters with DBR mirrors are discussed as well as guided-mode resonance structures based on InP membranes with photonic crystals. The aim of this work is the enhancement of these filter devices regarding their optical properties as well as processing quality. Therefore research on tailored stress and sacrificial layer wet etching, monolithic integration of a photodetector and related processes and also anti-reflective coatings on filter elements was conducted and results are given here. Finally, the investigation and results of a new polarising element with photonic crystals are presented.

**Key Words:** Periodic Structures, Optics, InP, MEMS, PhC

**Date:** September 2010

**Titel:** Periodische InP/Luft Strukturen in optischen Filterbauelementen

**Autor:** Thomas Kusserow

**Gutachter:** Prof. Dr. Hartmut Hillmer / Prof. Dr. Peter Meißner

**Zusammenfassung:** In dieser Arbeit werden periodische Strukturen, bestehend aus InP- und Luftelelementen, hinsichtlich ihrer Verwendung in optischen Filterbauelementen untersucht. Sowohl Fabry-Pérot Filter mit DBR Spiegeln als auch Strukturen, die geführte Resonanzen besitzen und auf InP-Membranen mit Photonischen Kristallen basieren, werden vorgestellt. Das Ziel dieser Arbeit ist die Verbesserung und Erweiterung von bestehenden Filtern bezüglich ihrer optischen Eigenschaften und Qualität des Herstellungsprozesses. Hierfür wurden Untersuchungen zur Kontrolle von Schichtverspannung und Opferschichtätzten, zur monolithischen Integration eines Photodetektors und damit verbundener Arbeitsschritte sowie zu reflexmindernder Schichten auf Filtern durchgeführt, deren Ergebnisse hier gezeigt werden. Zuletzt werden die Entwicklung eines neuartigen, polarisationselektiven Bauteils mit Photonischen Kristallen und die zugehörigen Ergebnisse präsentiert.

**Stichwörter:** Periodische Strukturen, Optik, InP, MEMS, PhC

**Datum:** September 2010



# Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Properties of Optical MEMS Filters with Periodic Structures</b>	<b>5</b>
2.1	Waves and Modes in Periodic Media and Thin Films . . . . .	5
2.2	Optical Properties of Fabry-Pérot Filters . . . . .	16
2.3	Guided-Mode Resonances in Structured Slab Wave Guides . . . . .	20
2.4	Photonic Crystals and their Application to MEMS Filters . . . . .	23
2.5	Mechanical Properties and Tuning Principles of MEMS Devices	26
<b>3</b>	<b>Design and Technology of InP/Air-gap Structures</b>	<b>29</b>
3.1	Properties of the InP/GaInAs Heterostructure System . . . . .	29
3.2	Processing InP/Air-gap MEMS Filters . . . . .	34
3.3	Numerical Methods for the Device Design . . . . .	41
3.3.1	The Transfer Matrix Method for Optical Thin-Films . . . . .	41
3.3.2	Finite-Difference Time Domain Method . . . . .	43
<b>4</b>	<b>Overview of the Current State of Research</b>	<b>47</b>
<b>5</b>	<b>Investigation on Processes Related to the Epitaxially Grown Multilayer Structures</b>	<b>53</b>
5.1	Tailored Gradient Stresses in InP/Air-gap Structures . . . . .	53
5.1.1	Introduction to Strain and Stresses in Thin-Film MEMS	55
5.1.2	Compensation of Gradient Stress in Thin InP Layers . . . . .	57
5.1.2.1	Epitaxial Growth with Increased V/III Ratio . . . . .	58
5.1.2.2	Gallium Containing Stress Compensation Layers	60
5.1.3	Influence of Lateral Nanoscale Structures on the Stress Compensation . . . . .	62
5.2	Wet Chemical Etching of GaInAs Sacrificial Layers . . . . .	64
5.2.1	Introduction to Wet Chemical Etching of III-V Compound Semiconductors . . . . .	65
5.2.2	Experimental Study of the Iron-(III)-Chloride Process . . . . .	68
5.2.3	Etch Selectivity in InP/GaInAs Multilayers . . . . .	73
5.2.4	Influence of the Semiconductor Dopant . . . . .	75

5.2.5	Etch Rates in Solutions with Different Concentration . . . . .	79
5.2.6	Photochemical Properties of the Etching Process . . . . .	82
5.2.7	Influence of the Thickness of the Sacrificial Layer . . . . .	87
5.3	Discussion of Results . . . . .	88
<b>6</b>	<b>Monolithically Integrated MEMS Fabry-Pérot Photodetector</b>	<b>91</b>
6.1	Design and Technology of the Integration Process . . . . .	91
6.1.1	Integration of the pin-Photodiode . . . . .	92
6.1.2	Absorbing Layer to Minimise Stray Light Detection . . . . .	95
6.1.3	Characterisation of the pin-Photodiode . . . . .	98
6.2	Ohmic Contacts on InP and GaInAs Layers . . . . .	100
6.2.1	Introduction to Metal-Semiconductor Contacts . . . . .	101
6.2.2	Ge/Ni/Au and Ti/Pt/Au Ohmic Contacts . . . . .	102
6.2.3	The Zn/Au Ohmic Contact . . . . .	104
6.2.3.1	Thermal Evaporation and Condensation of Zn . . . . .	104
6.2.3.2	Processing and Properties of Zn/Au Contacts . . . . .	107
6.3	Discussion of Results . . . . .	108
<b>7</b>	<b>Anti-reflective Coatings for Fabry-Pérot Filters</b>	<b>111</b>
7.1	Influence of Highly Refractive Substrates on Filter Spectra . . . . .	111
7.2	Properties of a Quarter Wave Low Refractive Index Layer . . . . .	113
7.3	Anti-reflective Effect of a Thin High Refractive Index Layer . . . . .	116
7.4	Discussion of Results . . . . .	120
<b>8</b>	<b>Polarisation Selective Filters with Photonic Crystals</b>	<b>121</b>
8.1	Polarisation Selectivity of InP Slabs with Resonant Structures . . . . .	122
8.2	Design of Photonic Crystal Slabs with Elliptical Air Cylinders . . . . .	123
8.3	Electron Beam Lithography Based Fabrication Approach . . . . .	125
8.3.1	Photonic Crystal Processing with Electron Beam Lithography . . . . .	126
8.3.2	Increasing the Dry Etch Resistance of PMMA Resists . . . . .	128
8.3.3	Photonic Crystal Structures in InP . . . . .	130
8.4	Focused Ion Beam Lithography Based Fabrication Approach . . . . .	131
8.4.1	Photonic Crystal Processing with FIB Lithography . . . . .	131
8.4.2	Properties of the Hardmask Layer . . . . .	135
8.4.2.1	Investigation on Hardmask Materials . . . . .	135
8.4.2.2	Etch Resistance of the Hardmask . . . . .	136
8.4.3	InP Slab Structures with Photonic Crystals . . . . .	139
8.5	Single Membrane Photonic Crystal Polarising Element . . . . .	141
8.6	Discussion of Results . . . . .	143
<b>9</b>	<b>Conclusion</b>	<b>145</b>
<b>Bibliography</b>		<b>149</b>

<b>Own Publications</b>	<b>179</b>
<b>List of Symbols and Abbreviations</b>	<b>183</b>
<b>Tabular Review of the Current State of Research</b>	<b>187</b>
<b>Acknowledgements</b>	<b>193</b>